

Anmeldung für eine Tagungsteilnahme

Bitte bis zum 7. November 2007 faxen an
(030) 63 92 – 65 01

Name _____

Vorname _____ Titel _____

Firma/Einrichtung _____

Adresse _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Spätmeldung Poster ja nein

Titel des Posters (eine Kurzfassung des Beitrages mit Angabe der
Co-Autoren und der zugehörigen Firmen / Einrichtungen bitte beifügen)

Teilnahmegebühren

100 € bei Überweisung bis zum 31. 10. 2007 Studentenrabatt 50 %,
150,00 € bei späterer Überweisung an:
IAP e.V. · Konto-Nr. 553 24 86 00 · Deutsche Bank AG Berlin · BLZ 100 700 00

Anmeldung von Ausstellungsfläche

4 m² 6 m² 8 m²

Aussteller können gegenwärtig ebenfalls noch Ausstellungsfläche mieten.
Die Miete beträgt noch 50 €/m² bei Anmeldung und Überweisung bis zum
22.10. 2007, bei späterer Überweisung 70 €/m².
Ein Vertreter des Ausstellers nimmt gebührenfrei an der Tagung teil.

Hotelreservierung

zu Vorzugspreisen von 57,00 € für ein EZ plus 11,00 € Frühstück

EZ DZ vom _____ bis _____

Ort, Datum

Unterschrift

Veranstalter

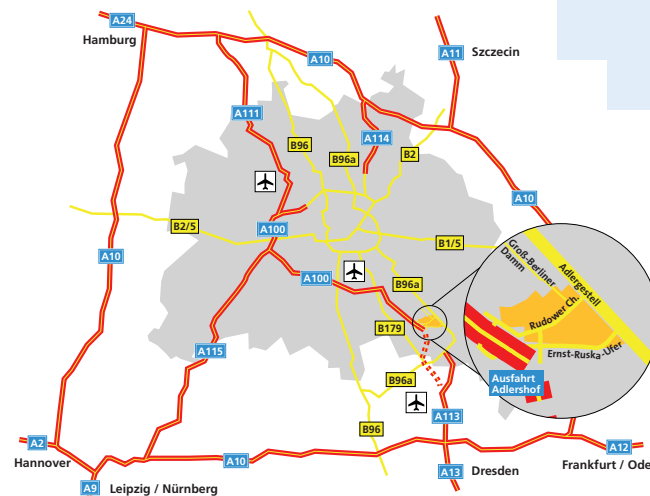
VDI/VDE – Gesellschaft Mess-
und Automatisierungstechnik (GMA);
VDI-Bezirksgruppe Adlershof;
Optec Berlin-Brandenburg e.V.;
IAP Institut für angewandte
Photonik e.V.;
IfG – Institute for Scientific
Instruments GmbH
FhG-IZM (Fraunhofer Institut
Zuverlässigkeit und Mikro-
integration), Berlin;
TSB – Technologiestiftung, Berlin
Geschäftsstelle Adlershof;
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin;
Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt, Braunschweig und Berlin
Technische Universität Berlin

Organisation und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ök. A. Weiß (Organisation)
Tel.: (030) 63 92 – 65 09
Fr. Ch. Rabe (Sekretariat IAP e. V.
und IfG GmbH)
Tel.: (030) 63 92 – 65 00
IAP Institut für angewandte
Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31
12489 Berlin
Fax: (030) 63 92 – 65 01
E-Mail: info@ifg-adlershof.de

Programmkomitee

E. Auerswald, IZM, Berlin
B. Beckhoff, PTB, Berlin
A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin
F. Burgäzy, Bruker axs GmbH,
Karlsruhe
W. Daum, BAM, Berlin
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG,
Duisburg
M. Haschke, IfG GmbH, Berlin
A. Janßen, FH Münster
K. Janssens, Universität
Antwerpen, Belgien
B. Kanngießner, TU Berlin
N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin
R. Meier, PANalytical, Almelo,
Niederlande
H. Miersch, Spectro
GmbH & Co. KG, Kleve
U. Panne, BAM und
Humboldt-Universität, Berlin
M. Procop, BAM, Berlin
W. Sandner, Max-Born-Institut
Berlin
G. Schneider, BESSY GmbH Berlin
Th. Schüle, Bruker axs
Microanalysis GmbH, Berlin
R. Wedell, IAP, Berlin
J. Wiesmann, Incoatec GmbH,
Geesthacht



Anfahrtskizzen auch unter www.wista.de

PRORA 2007

Programm

Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik

15. und 16. November 2007

am WISTA – Wissenschafts-
und Wirtschaftsstandort
Berlin-Adlershof
Einstein-/Newton-Kabinett
Bunsensaal

Rudower Chaussee 17
12489 Berlin



DO 15. November

10.00 – 10.15

Eröffnung N. Langhoff, G. Tränkle

Prozessanalytik in der Halbleitertechnologie

10.15 – 12.00

Leitung: J. Heckel

10.15 – 10.40

E. Zschech, M. Hecker (AMD Saxony LLC & Co. KG Dresden)

Das FABLAB-Konzept: Prozessnahe Röntgenanalytik in der Halbleiterindustrie

10.40 – 10.55

B. Beckhoff, R. Fliegauß, M. Kolbe, M. Müller, J. Weser, G. Ulm (PTB Berlin)
Kontaminationskontrolle von Halbleiteroberflächen durch referenzprobenfreie Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse

10.55 – 11.10

P. Hönick, B. Beckhoff, M. Kolbe (PTB Berlin)

Tiefenabhängige Nanoschichtanalytik von vertikalen Seitenwänden auf strukturierten Wafern

11.10 – 11.25

T. Feigl (Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Jena)
Automatisierte Röntgenreflektometrie von 300mm Wafern und EUV-Optiken

11.25 – 11.45

E. Blokhina (Röntgenanalytik Messtechnik GmbH)
Prozessnahe Schichtanalytik

11.45 – 12.00

M. Kolbe, B. Beckhoff (PTB Berlin)
Referenzprobenfreie Quantifizierung in der Röntgenfluoreszenzanalyse am Beispiel applikationsorientierter Dünnschichtsysteme

12.00 – 13.00 Uhr Mittagspause

Die Bedeutung von Atomdaten für die Röntgenfluoreszenzanalyse

13.00 – 14.00

Leitung: R. Wedell

13.00 – 13.25

M. Wendt, J. Dellith (IPHT e. V.), R. Terborg (Bruker AXS Microanalysis GmbH)
Neue Atomdaten für die Röntgenanalyse am Beispiel der M – Emissionsspektren der Elemente $39 \leq Z \leq 71$

13.25 – 13.40

M. Müller, B. Beckhoff (PTB Berlin), B. Kanngießer (TU Berlin), R. Fliegauß (PTB Berlin)
Hochauflösende Röntgenemissionspektrometrie im Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung zur Bestimmung atomarer Fundamentparameter für die RFA

13.40 – 13.55

B. Kanngießer, N. Dahlmann (TU Berlin), Y. Höhn (IfG GmbH), W. Malzer (Bruker AXS Microanalysis GmbH)
Quantifizieren ohne Nahtstellen – ein neuer Quantifizierungsalgorithmus für die Röntgenfluoreszenzanalyse

Neue Entwicklungen bei Komponenten für röntgenanalytische Geräte

14.00 – 17.00

Leitung: Th. Schüle

14.00 – 14.25

F. Scholze (PTB)
Entwicklungsstand moderner Röntgendetektoren und ihre Einsatzmöglichkeiten in der Prozessanalytik

14.25 – 14.40

A. Niculae (PN Sensor GmbH)
PN Detectors for High Rate Resolution X-Ray Spectroscopy and Imaging

14.40 – 14.55

O. Boslau, J. Kemmer, A. Pahlke, St. Pahlke, T. Eggert, R. Stötter (KETEK GmbH)
Neuartige Silizium-Drift-Detektoren der 5. Generation mit hoher Zuverlässigkeit für die steigenden Ansprüche industrieller und analytischer Anwendungen

14.55 – 15.25 Kaffeepause

15.25 – 15.40

A. Kharchenko (PANalytical, Almelo) PIXel – ein Detektor für alle Applikationen

15.40 – 15.55

M. Krumrey (PTB)
Röntgenoptische Systeme – Neue VDI-Richtlinie 5575

15.55 – 16.10

Ch. Schroer (TU Dresden)
Refraktive Optiken für die Röntgenmikroskopie

16.10 – 16.25

V. D. Hodoroaba, M. Procop (BAM), A. Bjeoumikhov (IfG GmbH), V. Arkadijev (IAP e. V.), M. Haschke (IfG GmbH)

Bestimmung der aktuellen Transmission einer Röntgen-Minilense durch Vergleich von berechneten mit gemessenen Streuspektren

16.25 – 16.40

H. Legall, H. Stiel (MBI)
Thin films of pyrolytic graphite as component for X-ray spectroscopy

16.40 – 16.55

P. U. Pennartz (Rigaku)
Neue Micro-Focus Quellen

Postersession und Rundgang durch die Firmenausstellung

17.00 – 18.45

Eröffnung: B. Beckhoff

P. U. Pennartz (Rigaku)

Multilayer gratings for the use in x-ray optics

C. Peth; A. Bayer, F. Barkusky, J. Dette, A. Kalinin, S. Doering, K. Mann (Laser Labor Göttingen e. V.)
Compact laser driven plasma source for soft X-ray absorption spectroscopy

Th. Holz (AXO DRESDEN GmbH)
ASTIX-Optics for focusing of Cu- and Mo-radiation

S. Noack, M. Michaelis, M. Ostermann (BAM)

Die Rekonstruktionsmethode – eine robuste, quantitative RFA Methode zur Realisierung der Richtigkeit und Anbindung an das SI System

St. Döring, F. Barkusky, A. Bayer, J.-O. Dette, C. Peth, K. Mann (Laser Labor Göttingen e. V.)
Laboratory – scale EUV reflectometry based on a laser plasma source

F. Reinhardt, B. Beckhoff, B. Kanngießer, M. Müller, B. Pollakowski, G. Ulm (PTB Berlin)

Hochauflösende Röntgenemissions- und Röntgenabsorptionsspektroskopie an Titanverbindungen

P. Hoghoj (XENOCS)

X-ray beam delivery system for high throughput process monitoring

R. Arnhold, M. Rohde (Bruker AXS Microanalysis GmbH)
Einsatz von großflächigen Silizium-Drift-Detektoren in der Röntgendiffraktometrie

U. Waldschläger (Bruker AXS Microanalysis GmbH)

Analyse von Spurenelementen in Öl- und Filterproben unter Anwendung der Totalreflexionsröntgen-

fluoreszenzanalytik (TRFA)

M. Procop (BAM)

Computer-Programm zur Modellierung der Spektrometerantwortfunktion eines energiedispersiven Röntgenspektrometers

A. Wittenberg, M. Kraml (BGR Hannover), C. Berthold (Institut f. Geowissenschaften, Tübingen), R. van Geldern (GGA-Institut, Hannover), V. Kato (GSMD, Entebbe), D. Delvaux (RMCA, Tervuren)
Geochemical travertine records – insights from μ -EDXRF and μ -XRD

A. Simsek (PN Sensor GmbH)
High Performance SDD Detectors with integrated FET for X-Spectroscopy

V. Nikolaev (Scientific Instruments, St. Petersburg)
XRF and XRD in the aluminum industry

A. Bjeoumikhov (IfG GmbH), S. Bjeoumikhova (BAM)
Röntgenkapillaroptiken

A. Bjeoumikhov (IfG GmbH), S. Bjeoumikhova (BAM)
Neue Applikationen von Röntgenkapillaroptiken

J. Wiesmann, A. Oehr (Incoatec GmbH)
Improvement of X-ray Analytics using Nanotechnology

Aussteller

Analyticon Instruments GmbH, AXO Dresden GmbH, Bruker AXS Microanalysis GmbH, EFG GmbH, Helmut Fischer GmbH & Co. KG, IfG Institute for Scientific Instruments GmbH, Incoatec GmbH, KETEK GmbH, PANalytical (Netherlands), PN Sensor GmbH, Oxford Instruments GmbH, Rigaku Innovative Technologies (USA), Röntgenanalytik Messtechnik GmbH, rtw Dr. Warrickhoff Röntgen – Technik GmbH & Co. KG, SPECTRO Analytical Instruments GmbH & Co. KG, Thermo Fisher Scientific Inc., XENOCS (France)

19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen

FR 16. November

Applikationen in Industrie und Forschung

9.00 – 10.45

Leitung: M. Haschke

9.00 – 9.25

U. Ewert, K. Osterloh (BAM, Berlin)
Röntgenverfahren für den Bereich

der Security

9.25 – 9.40

U. Waldschläger (Bruker AXS Microanalysis GmbH)
Ultra-Spurenanalytik mit dem Benchtop TRFA Spektrometer S2 PICOFOX

9.40 – 9.55

J. Wess (PANalytical)
Bestimmung der Dicke und Zusammensetzung von produzierten Schichten mittels der Mikrofluoreszenzanalyse

9.55 – 10.10

A. Janßen, Chr. Mans, St. Hanning, M. Kreyenschmidt (FH Münster), M. Haschke (IfG GmbH, Berlin)
Einsatzmöglichkeiten der RFA bei Optimierungen in der Kunststoffherstellung und -Verarbeitung

10.10 – 10.25

F. Mollekopf (Thermo Fisher Scientific Inc.)
ARL 9900 Series X-ray Workstation Integrating XRF and Full XRD in a Single Instrument

10.25 – 10.40

H. Poellmann (Universität Halle)
Reaktionskinetische Untersuchungen der Erstarrung von Zement

10.45 – 11.15 Uhr Kaffeepause

11.15 – 13.00

Leitung: M. Procop

11.15 – 11.40

J. Angeli (voestalpine Stahl GmbH, Linz)
Automatische REM/EDX-Analytik zur Ermittlung von nichtmetallischen Einschlüssen in modernen Stählen

11.40 – 11.55

J. Flock, U. Thurmarm (ThyssenKrupp Steel AG, Duisburg)
Glasartige Referenzmaterialien für die Produktionskontrolle in der Eisen- und Stahlindustrie

11.55 – 12.10

A. Klein, G. Ma (Indutech Instruments GmbH), R. Mayerhofer, M. Zahn, J. Zimgast (voestalpine Stahl Donawitz GmbH & Co. KG)
Online Bestimmung der Basizität der Sintermischung mittels Röntgenfluoreszenz

12.10 – 12.25

T. Salge (Bruker AXS Microanalysis

GmbH)

Neue Anwendungsmöglichkeiten und Potentiale der orts aufgelösten Röntgenmikrobereichsanalyse mit dem Quantax EDS System

12.40 – 12.55

F. Eggert (IAP e.V.), W. T. Elam (EDAX), M. Haschke (IfG GmbH)
Kombinierte ESMA / Mikro-RFA Analyse derselben Probe mit iMOXS-Quant

13.00 – 14.00 Uhr Mittagspause

Spezielle Entwicklungen

14.00 – 15.45

Leitung: B. Kanngießer

14.00 – 14.15

A. Wittenberg, S. Dorndorf (Institut für Mineralogie, Leibniz Universität Hannover), M. Huyskens (Institut für Mineralogie, Universität Münster), A. Scheibner, D. Rammlmair (BGR Hannover)
Beispiele zur ortsauflösenden Röntgenanalytik in den angewandten Geowissenschaften – Ein Methodenvergleich

14.15 – 14.30

I. Mantouvalou (TU Berlin), W. Malzer (Bruker AXS Microanalysis GmbH), L. Lühl, B. Kanngießer (TU Berlin)
Quantitative 3D Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse an Schichtsystemen

14.30 – 14.45

B. Pollakowski, B. Beckhoff, St. Braun, P. Gawlitzka, F. Reinhardt, G. Ulm (PTB)
Zerstörungsfreie Speziation von vergrabenen TiOx Nanoschichten

14.45 – 15.00

J. Piltz (amtec GmbH)
RFA-Messungen in Vakuum-Beschichtungsanlagen

15.00 – 15.15

A. Oehr, J. Wiesmann, C. Michaelsen, J. Graf, A. Sabeti, K. Wulf, Ch. Hoffmann (Incoatec GmbH)
Neueste Entwicklungen im Bereich wartungsarmer, transportabler Röntgendiffraktometer

15.15 – 15.30

Th. Holz (AXO DRESDEN GmbH)
 α – TWIN's – X-ray reflectometry in the range of 2 nm – 600 nm with multilayer mirrors

15.30 – 15.45

Schlusswort